



に複雑なサイクロトロン共鳴とその膜厚依存に関する興味深いデータを初めて得ることができました。

特に試料膜厚による急激な共鳴吸収強度の変化はキャリア濃度の変化と直接関係し、フェルミエネルギーと電子や正孔バンドとの相対的なエネルギー位置の変化によるものと考えられ、現在、薄膜試料における膜厚による金属絶縁体転移の可能性について検討しているところです。

今回久しぶりに行わせていただいた超強磁場サイクロトロン共鳴測定ですが、ある意味非常に強力なオンリーワンツールともなりますので、このままで立ち止まることなく、是非ともさらなる発展を、特に若い強磁場研究者に目指していただければと個人的には思っております。

最後に今回の客員所員の活動を受け入れていただいた松田康弘先生、ハードな実験を毎回お手伝いいただいた Yang Zhuo 君、強磁場関係者の皆様に感謝いたしまして、私の客員所員の体験談を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。

